

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年6月6日(06.06.2024)



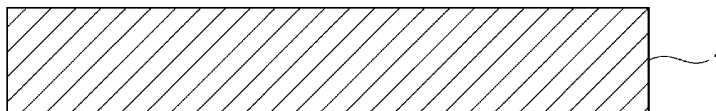
(10) 国際公開番号

WO 2024/117184 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) B01J 41/04 (2017.01)
B01J 39/04 (2017.01) B01J 41/14 (2006.01)
B01J 39/20 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/042745
- (22) 国際出願日: 2023年11月29日(29.11.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-191776 2022年11月30日(30.11.2022) JP
- (71) 出願人: 東ソー株式会社 (TOSOH CORPORATION) [JP/JP]; 〒7468501 山口県周南市開成町4 5 6 0番地 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者: 幸田 陽一朗 (KODA Yoichiro); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川2 7 4 3番地1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP). 松永 修 (MATSUNAGA Osamu); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川2 7 4 3番地1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP). 正能 大起 (SHONO Daiki); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川2 7 4 3番地1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP). 召田 雅実 (MESUDA Masami); 〒2521123 神奈川県綾瀬市早川2 7 4 3番地1 東ソー株式会社 東京研究センター内 Kanagawa (JP).
- (74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA Yoshiki et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 9階 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) Title: MOLYBDENUM SPUTTERING TARGET, METHOD FOR MANUFACTURING SAME, AND FILM FORMING METHOD FOR MOLYBDENUM FILM

(54) 発明の名称: モリブデンスパッタリングターゲット、その製造方法及びモリブデン膜の成膜方法



(57) Abstract: Disclosed is a molybdenum sputtering target that has a metal impurity content of 100 mass ppm or less, a tungsten content of 50 mass ppm or less, and an oxygen concentration of 50 mass ppm or less.

(57) 要約: 金属不純物の含有量が100質量ppm以下で、なおかつ、タングステン含有量が50質量ppm以下であり、酸素濃度が50質量ppm以下であるモリブデンスパッタリングターゲットが開示されている。

[続葉有]

WO 2024/117184 A1

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）